

大気圧 プラズマクリーニングシステム SSC-APシリーズ

独自のArPシステム(APP PAT) による、大気圧下でもArイオンによる高効率かつ安定的な表面改質処理が可能となりました。
昨今、市場ニーズが高くなっている、ハイタクト・省エネ・省スペース、メンテナンス性を実現したシステム提案が可能です。



ダイレクトプラズマ"ArP®"の採用

これまでにない大気圧プロセスをお客様に・・・
コンパクト・シンプル・高効率を実現させた、
APP社製モジュールを採用し、これまで大気圧下では
安定したプラズマ放電が困難と言われていたArガスを、
メインプロセスガスとして採用する事に成功。

これにより大気圧でも真空でのRIEプラズマに近い
処理効果を達成。
神港精機はArPシステムをベースに、様々なシステムユニットを
ご提案いたします。

用途・特長



主な効果

静電気除去・有機物除去・ナノエッチング・表面活性化



用途例

フィルム表面のクリーニング・半導体リードフレーム
BGA基板のクリーニング・実装関係部品の表面改質・医療
部品の表面改質、その他電子関係部品全般の表面改質



低ランニングコスト 省エネルギー

高効率なノズル設計を行う事により、
他社製品対比でガス使用量を1/10に。
また、消費電力量の削減も達成

Our Solution

システム提案

- ・カスタムモデル提案が可能
- ・CtoCモデルの提案
- ・RtoRモデルの提案
- ・真空プラズマとの複合プロセス提案

トレサビリティーシステム

- ・QRコードによる製品トレサビリティー対応
- ・上位通信システムも対応可能
- ・その他カスタマイズ対応可能

カタログモデル販売

- ・R&DモデルとしてAPP社カタログモデル
の輸入・販売も対応いたします
- ・輸入~据付~アフター保守まで対応可能

サンプルテスト

- ・サンプルデモ可能
- ・接触角測定をオンサイトで可能
- ・真空プラズマとの比較テスト可能
- ・オンサイトデモンストレーション可能



THINK TOMORROW

SHINKO SEIKI

神港精機株式会社

Contact Us



03-3271-2156(東京)
078-332-3400(神戸)



www.shiko-seiki.com

SSC-AP SERIES TECHNOLOGY SOLUTION



ダイレクトプラズマ方式

大気圧プラズマの中でも、イオンによる処理効果が高いダイレクトプラズマ方式を採用。
これまで大気圧下では放電安定性が難しかったと言われていた、Arプラズマにおいても
APP社独自のArP®技術により、安定性・分布・高効率・低消費電力・低ガス消費量を達成。

ARP®テクノロジー

APP社にて特許技術（JP）特表P2010-518555A取得

RF印加電圧の均一化
ガス供給方式の独自開発によるプラズマ放電の安定化
補助プラズマ機構による低電圧放電
誘電体コートによるアーク放電の抑制
ガス消費量の抑制
狭ギャップ放電

対応プロセスガス

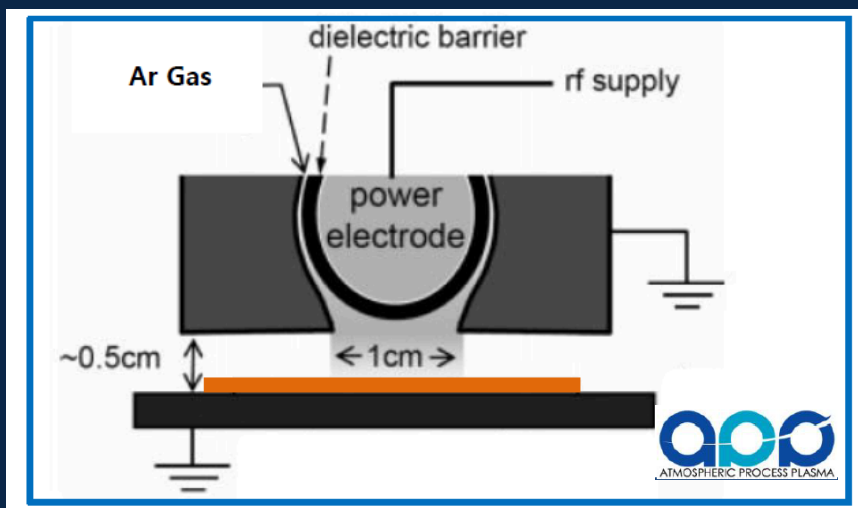
Ar, O₂, N₂, H₂, CDA対応

プラズマ発光エリア

マガジンtoマガジンモデル放電エリア L:300mm×H:10mm

放電長さ(L値)のサイズはカスタマイズ対応可能。

プラズマ照射時は処理物もしくはArPヘッドを移動させ、処理物全面のプラズマ処理を行います。



ArP-100C型（デモ機）



デモテストは
ArP-100C型(プラズマ照射幅100mm)
にてトライアル可能。
真空中プラズマとの比較トライアルも
受付可能です。



COMING
SOON

QFN/BGA/LF基板用
マガジンtoマガジン
モデル開発中